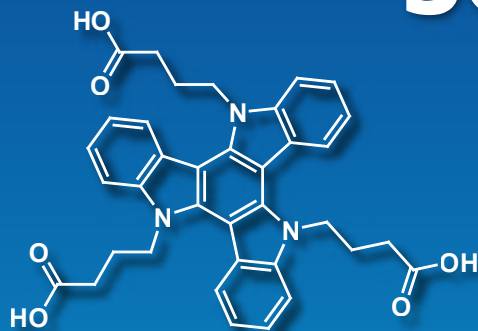


カルボン酸部位を有する トリポッド型SAM形成試薬 3CATAT-C3

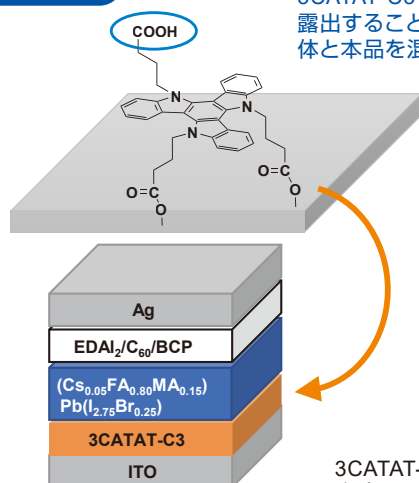


3CATAT-C3
500mg 32,000円
[C4192]

特長

- 優れたホール回収能力
- 大面積化に有利な高い濡れ性
- 正孔回収層とペロブスカイト層を同時に成膜可能
- 高純度品/大量供給が可能

利用例



3CATAT-C3は逆型ペロブスカイトに利用できる高性能正孔回収材料です。カルボキシ基の一部が部分的に露出することで、ペロブスカイト層成膜に適した高い濡れ性の単分子膜を形成します。ペロブスカイト前駆体と本品を混合してITO上に塗布することで、正孔回収層とペロブスカイト層を同時に形成できます¹⁾。

| 正孔回収材料 | Method | J _{sc} (mA·cm ⁻²) | V _{oc} (V) | FF | PCE (%) |
|-----------|----------------------------------|---|------------------------|------|------------|
| 3CATAT-C3 | Spin-coating (Layer by layer) | 23.6 | 1.07 | 0.84 | 21.2 |
| 3CATAT-C3 | Spin-coating (Co-deposition) | 23.7 | 1.08 | 0.81 | 20.8 |
| 3PATAT-C3 | Spin-coating (Layer by layer) | 24.7 | 1.12 | 0.82 | 22.7 |
| 3PATAT-C3 | Spin-coating (Co-deposition) | 22.0 | 0.99 | 0.79 | 17.3 |

3CATAT-C3 [C4192]は高性能正孔回収材料である3PATAT-C3 [P3172]に匹敵する高い性能を示します。3CATAT-C3はCo-deposition法でもLayer by layer法による成膜と同様の性能を示します。

引用文献 1) M. A. Truong, A. Wakamiya, et al., *J. Am. Chem. Soc.* **2025**, 147, 2797. <https://doi.org/10.1021/jacs.4c15857>

本製品は若宮淳志教授の技術指導の下で、株式会社エネコートテクノロジーズからのライセンス許諾を受けて製品化されました。

関連製品

- 3PATAT-C3** 500mg [P3172]
Lead(II) Iodide (99.99%, trace metals basis) [for Perovskite precursor] 1g / 5g / 25g / 100g / 1kg [L0279]
Lead(II) Bromide (Low water content) [for Perovskite precursor] 1g / 5g / 25g / 100g [L0346]
Formamidinium Hydroiodide (99.99%, trace metals basis) [for Perovskite precursor] 1g / 5g / 25g [F1263]
Methylamine Hydrobromide (Low water content) 1g / 5g / 25g [M2589]

東京化成工業株式会社

試薬製品について

■本社営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-3668-0489 Fax: 03-3668-0520 E-mail: Sales-JP@TCIchemicals.com

■大阪営業部 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-21 第2中井ビル1階
Tel: 06-6228-1155 Fax: 06-6228-1158 E-mail: osaka-s@TCIchemicals.com

スケールアップ、受託サービス(合成・開発・製造)について

□化成品営業部 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16-12 T-PLUS 日本橋小伝馬町8階
Tel: 03-5651-5171 Fax: 03-5640-8021 E-mail: finechemicals@TCIchemicals.com

弊社製品取扱店

本誌掲載の化学品は試験・研究用のみ使用するものです。化学知識のある専門家以外の方のご使用はお避けください。品目や製品情報等、掲載内容の変更を予告なく行う場合があります。内容の一部または全部の無断転載・複製はご遠慮ください。